ヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池を用いた II-V//Siスマートスタック

水野 英範1、牧田 紀久夫2、齋 均2、望月 敏光1、松井 卓矢2、高遠 秀尚1、 Ralph Müller³、David Lackner³、Frank Dimroth³、菅谷 武芳² 1 産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 2 産業技術総合研究所 ゼロエミッション国際共同研究センター **3 Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems**

スマートスタックとは?

われわれが提案するタンデム型(多接合)太陽電池の作製方法であり、その特徴は 金属ナノ粒子配列を異種太陽電池の接合媒体として用いていることである。[1,2]

Siタンデム太陽電池

現在の結晶Si太陽電池は、研究開発レベルではセル効率26%以上、モジュール効率 24%以上の報告がなされている。他方で、結晶Si太陽電池の理論限界効率は Detailed Balance Theoryによれば29%程度(セルの場合)と言われており、更なる高 効率化(30%以上)を実現するためには何らかの工夫が必要となる。



これまでにTOPCon型結晶シリコン太陽電池をボトムセルとして用いたIII-V/Siス マートスタックで変換効率30.8%を達成している。^[3]本発表では、シリコンヘテロ接合 (SHJ)をボトムセルとして用いた「III-V/SHJスマートスタックセル」についての検討 結果を報告する。

有効な手段の一つは、結晶Siとは異なる太陽電池材料を積層することで得られる多 接合またはタンデム型と呼ばれるデバイス構造を導入することである。これらの太陽 電池では、紫外から赤外という幅広い波長を有する太陽光を各々の太陽電池(光電) 変換層)で有効に電気に変換できるため、従来の単接合型太陽電池と比較して大幅 な変換効率の向上が可能となる。









⇒ 特性が著しく改善(nc-Si:H層によるa-Si:H層の保護、導電性の改善)



a) SHJセル上へのPd NPアレイの作製

- b) III-V族化合物セルのELOとPDMSによるピックアップ
- c) Pd NPアレイで装飾されたSHJセル上のIII-V族セルの接合、NH₄OH/H₂O₂による III-V族セルのキャップ層の除去、SiO₂/TiO₂ベースのARCの成膜。

まとめ:a-Si:HキャップのSHJセル上にPdナノ粒子配列を直接作製すると、接合抵抗が高く 、SHJセルのパッシベーション効果も失われ、良好なタンデム特性が得られなかった。そこ で、Pdナノ粒子配列とSHJセルの間に水素化ナノ結晶Si(nc-Si:H)層を導入し接合抵抗の 改善とパッシベーション効果の保持を図った。このようなnc-Si:HキャップのSHJセルを InGaP/AlGaAs 2接合セルと組み合わせ、27.4%の変換効率(AM1.5G条件下)を達成した。 EQEからは、ボトムSHJセルでJ。が律速されていることが確認された。接合界面ギャップの 制御により、更なる高効率化(TOPConの場合の30.8%を超える効率)が可能と考えられる。

参考文献

[1] H. Mizuno, K. Makita, and K. Matsubara, *Appl. Phys. Lett.*, **101**, 191111 (2012). [2] H. Mizuno, et al., Jpn. J. Appl. Phys., 55, 025001 (2016). [3] K. Makita, et al., Prog. Photovolt: Res. Appl., 28, 16 (2020). [4] H. Mizuno, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.1c22458 (2022).

